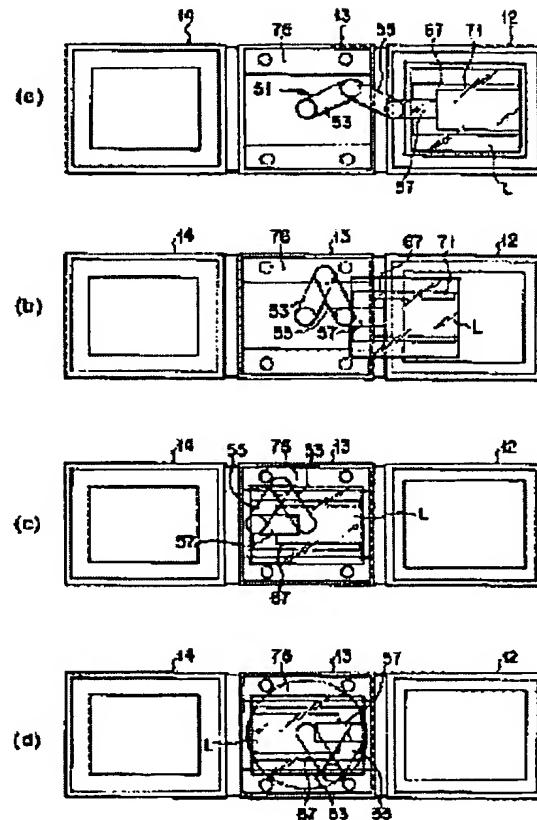


# CONVEYER AND CONTAINER FOR SEMICONDUCTOR TREATMENT AND THE SEMICONDUCTOR TREATMENT SYSTEM

**Patent number:** JP2001148410  
**Publication date:** 2001-05-29  
**Inventor:** HIROKI TSUTOMU  
**Applicant:** TOKYO ELECTRON LTD  
**Classification:**  
 - international: H01L21/68; B25J9/06; B25J15/08; B25J17/00; B25J18/02; B65G49/07  
 - european:  
**Application number:** JP20000264261 20000831  
**Priority number(s):**

## Abstract of JP2001148410

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a conveyor for semiconductor treatment which can suppress increase in a revolving space for changing the conveying direction, even if a substrate to be treated becomes large in size.  
**SOLUTION:** A conveyor for an LCD substrate includes a multijoint arm unit 51, which is attached to a support base rotatably and expandably in the horizontal plane. The multijoint arm unit 51 has a tip arm 57, which is reciprocally moved in a conveying direction by the expansion/contraction thereof. A support member 67 for supporting the LCD substrate is provided on the tip arm 57. The support member 67 is attached to the tip arm 57, to be moved reciprocally in the conveying direction. A pair of temporary holding shelves 76, which holds the support member 67 when the multijoint arm unit 51 and the support member 67, are contracted for supporting the LCD substrate are provided. Only the multijoint arm unit 51 is turned to change the conveying direction, while the LCD substrate is put on the temporary holding shelves 76.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2001-148410  
(P2001-148410A)

(43) 公開日 平成13年5月29日 (2001.5.29)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	マークシート (参考)
H 0 1 L 21/68		H 0 1 L 21/68	A
B 2 5 J 9/06		B 2 5 J 9/06	D
	15/08	15/08	Z
	17/00	17/00	G
	18/02	18/02	

審査請求 未請求 請求項の数20 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-284261(P2000-284261)  
(22) 出願日 平成12年8月31日 (2000.8.31)  
(31) 優先権主張番号 特願平11-251445  
(32) 優先日 平成11年9月6日 (1999.9.6)  
(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 000219967  
東京エレクトロン株式会社  
東京都港区赤坂5丁目3番6号  
(72) 発明者 広木 勲  
山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1  
東京エレクトロン山梨株式会社内  
(74) 代理人 100058479  
弁理士 鈴江 武彦 (外5名)

(54) 【発明の名称】 半導体処理用の搬送装置及び収容装置、並びに半導体処理システム

(57) 【要約】

【課題】 被処理基板の大型化にかかわらず、搬送方向を変換するための旋回用スペースの増大を抑制することが可能な半導体処理用の搬送装置を提供する。

【解決手段】 L C D基板の搬送装置は、水平面内で回転且つ伸縮可能に支持ベースに取り付けられた多関節アーム部51を含む。多関節アーム部51は、その伸縮によって搬送方向において往復を行う先端アーム57を有する。先端アーム57上にL C D基板を支持するための支持部材67が配設される。支持部材67は、搬送方向において往復可能に先端アーム57に取り付けられる。多関節アーム部51及び支持部材67が収縮した状態において支持部材67を挟むように、L C D基板を支持するための一対の預かり棚76が配設される。預かり棚76上にL C D基板を置いた状態で、多関節アーム部51のみが回転して搬送方向を変換する。

